

スパッタ装置

研究開発から生産まで対応

研究開発装置 EB1000 / 生産装置 EB1100, EC7000, IC1060

EB1000



実験・研究開発に最適なスパッタ装置
教育用装置としてもお勧め

特長

- ・小径(φ 2")カソードで最大3元同時成膜が可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・小スペースに設置可能

EB1100



高温成膜や低温成膜も可能なスパッタ装置
研究から少量生産まで対応

特長

- ・φ 4"(最大4基)、φ 12.5"(1基)カソードに多種多様なターゲットを搭載可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・搬送から成膜まで全自動運転

EC7000/7001



製品向けスパッタ装置
各種デバイス開発から量産まで対応

特長

- ・φ 4"(最大4基)、φ 12.5"(1基)カソードに多種多様なターゲットを搭載可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・カセット室/トランスファ室装備

IC1060



生産向けスパッタ装置
電極・配線・UBMなどに対応

特長

- ・ウェハーサイズφ150 mm、φ 200 mm
- ・最大6チャンバ搭載のクラスター装置 (PVD×4(Max)、Etch、Heat)
- ・OHTやオンラインも対応